# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

## (11) 許出職公開 号 特開平7-45748

(43)公開日 平成7年(1995)2月14日

(51) Int.Cl.4

FΙ

技術表示信所

H01L 23/14 C30B 29/04

X 8216-4G

H01L 23/14

D

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

(21)出顯番号

(22)出顧日

特顧平5-192118

平成5年(1993)8月3日

(71)出題人 000002130

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72)発明者 山本 喜之

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友

電気工業株式会社伊丹製作所内

(72)発明者 今井 貴浩

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友

電気工業株式会社伊丹製作所内

(72)発明者 蘇森 直治

兵庫県伊丹市昆脇北一丁目1番1号 住友

電気工業株式会社伊丹製作所内

(74)代理人 弁理士 上代 哲司 (外2名)

### (54) 【発明の名称】 半導体装置用基板

### (57)【要約】

結晶性は比較的悪く、しかし放熱性の高い安価な半導体 実装用ダイヤモンド基板。

【目的】 高い放熱性を保持しながらかつ安価に製造で きるダイヤモンド基板。

【構成】 ダイヤモンドの誘電特性、結晶性を低下させ ることにより、高熱伝導性を維持しながら、ダイヤモン ド基板製造のコストを大幅に低下させることができる。

PARTIAL TRANSLATION OF JAPANESE UNEXAMINED PATENT PUBLICATION NO. 7-45748

Title of the Invention: Board for Semiconductor Device

Publication Date: February 14, 1995

Patent Application No. 5-192118

Filing Date: August 3, 1993

Applicant: Semitomu Denki Kogyo Co., Ltd.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (EXCERPT)

### Example 1

Diamond was grown to 300  $\mu m$  on a polycrystalline Si board (25  $\times$  2.5  $\times$  5 mm) by use of a heat filament CVD method. In the above composite condition, high purity hydrogen including methane of 6% was supplied as a raw material, the pressure was 70 Torr and the temperature of the board was 850°C. The film growing speed was 7.5  $\mu m/hr$  (sample A). On the other hand, as a comparison example, the composite condition was modified to hydrogen including methane of 2%, a pressure of 30 Torr and the board temperature of 900°C to allow the diamond to grow to 200  $\mu m$ . The film growing time was 100 hr and the film growing speed was 2.0  $\mu m/hr$  (sample B).

### Example 2

Diamond was grown on a polycrystalline Si board  $(25 \times 25 \times 5 \text{ mm})$  by use of a heat filament CVD method under a condition as shown in Table 1 (samples C to E). These samples were subjected to the same treatment as in example 1. The results from Raman spectral analysis, dielectric characteristic measurement and thermal conductivity measurement are shown in Table 1.